

3rd announcement

Celebrating 40 years

ドライプロセス国際シンポジウム

International Symposium on Dry Process (DPS2018)

2018年11月13日(火)~15日(木)

名古屋大学 豊田講堂ホール

The past, present, and future on dry process



11月13日(火) 40回記念事業 – 特別プログラム

ドライプロセスシンポジウムはドライエッチングを中心とするプラズマ関連の学会で、今年で40回を迎えることとなります。これを記念して若手を中心に過去を振り返り、未来に向けての発展の方向性を議論するという企画を記念イベントとして開催することに致しました。

プラズマの新たな発展分野についてIoT, エネルギー, デバイス, クルマ, 医療, ロボットなど, 社会基盤との連携も含めて, それぞれの分野を牽引する著名な方々をお招きし, 今後10年から先を見越した展望をご説明していただきます。未来に繋がるアプローチとともに, パネルディスカッションも開催致します。

特別プログラム参加費無料

英日同時通訳あり



13:00 - 14:00

小池 淳義 (サンディスク, ウェスタン・デジタル)

- Advanced Semiconductor Manufacturing - Intelligent Fab Systems and Smart Equipment



14:00 - 14:30

リチャード・ファン・デ・サンデン

(The Eindhoven University of Technology (TU/e), the Netherland)

"Renewable energy driven non-equilibrium chemistry: plasma chemistry as the special case"



14:30 - 15:00

若林 整 (東京工業大学)

"Benchmark on Advanced Logic Devices and Predictive Discussion on Future LSIs"



15:00 - 15:30

原田 香奈子 (科学技術振興機構/東京大学)

"Bionic Humanoids: current research and future vision"



15:30 - 16:00

森川 高行 (名古屋大学)

"Mobility Services with Autonomous Cars in Nagoya University COI Project"

パネルディスカッション 16:30 - 17:30

未来技術への挑戦(IoT, エネルギー, ビックデータ, 人工知能, デバイス, クルマ, 医療, ロボット, シェアリングエコノミーなど)

Website: <http://www.dry-process.org/2018/>

3rd announcement

Celebrating 40 years

ドライプロセス国際シンポジウム

International Symposium on Dry Process (DPS2018)



40回記念事業特別プログラム(参加費無料)に引き続く11月14日と15日の2日間は、例年開催しておりますドライプロセス国際シンポジウム(DPS2018)が40回記念を迎えます。会場は、同名古屋大学豊田講堂ホールで、通常の講演に加えて、Society 5.0やIoTで注目されるコンピューティング技術を支えるプロセス・メモリ・センサ・パワーデバイスの製造に欠かすことのできないプラズマ堆積・エッチング技術に関する高アスペクト比構造の原子スケール精度の実現と制御に向けた表面反応科学の理解とそれを通じた工学制御について議論するセッションを開催します。奮ってご参加のほどお願いいたします。

11月14日(水), 15日(木) DPS2018招待講演

参加登録必要(有料)

Keynote speaker **Richard Gottscho** (Lam Research Corp.) 9:40 – 10:20 AM, Nov. 14

"Rethinking the Art of Etch"

Invited speakers

Arranged session: **A1. Control of surface reactions in atomic-precision plasma processing (ALE/ALD)**

Gottlieb S. Oehrlein (University of Maryland) 10:20 – 11:00 AM, Nov. 14

"Materials Etching Selectivity in Plasma-Based Fluorocarbon Atomic Layer Etching (ALE) "

Emilie Despiau-Pujo (University of Grenoble Alpes) 11:20 – 12:00 AM, Nov. 14

"Plasma solutions for atomic-precision etching: From atomistic simulations to experiments"

Silvia Armini (imec) 9:30 – 10:10 AM, Nov. 15

"Area-selective deposition by surface engineering for applications in nanoelectronics. From blanket to confined dimensions."

Gert Leusink (Tokyo Electron U.S.) 10:10 – 10:50 AM, Nov. 15

"Area Selective Processes for Advanced Devices: Challenges and Opportunities"

Arranged session: **A2. Etching challenges in extremely high-aspect-ratio (HAR) features (AR > 100)**

Sangwuk Park (Samsung Electronics Co., Ltd.) 15:10 – 15:50 PM, Nov. 15

"Etching challenges in extremely high-aspect-ratio (HAR) features"

General session:

Nathan Marchack (IBM Corp.) 13:50 – 14:30 PM, Nov. 15

"Towards Atomic Layer Etching of Metal Nitride Films: Understanding the Impact of Plasma Etch Parameters on Cyclic Etch Performance"

Yasuhiro Morikawa (ULVAC Inc.) 16:40 – 17:20 PM, Nov. 14

"Plasma Dry Process Technology for Fan-out SiP"

For further general information, please contact: [e-mail:dps2018@officepolaris.co.jp](mailto:dps2018@officepolaris.co.jp)

Organizing Committee Chair: Keizo Kinoshita (AIO Core Co., Ltd.)

Executive Committee Chair: Masaru Hori (Nagoya University)

Program Committee Chair: Masanaga Fukasawa (Sony Semiconductor Solutions Corp.)

Publication Committee Chair: Tatsuo Ishijima (Kanazawa University)

Ad Hoc Committee Chair for 40th Anniversary Project: Kenji Ishikawa (Nagoya University)

On-line Registration: http://www.dry-process.org/2018/online_registration.html